

## 플렉서블 디스플레이에의 적용을 위한 저온 게이트 절연막에 대한 연구

장경수<sup>1</sup>, 백경현<sup>1</sup>, 최우진<sup>1</sup>, 안시현<sup>1</sup>, 박철민<sup>1</sup>, 이준신<sup>1</sup>

<sup>1</sup>성균관대학교

현재 디스플레이의 연구의 최종목표는 저온 공정을 이용한 플렉서블 디스플레이의 적용이다. 이를 위해 채널 영역, 도핑, 기판 및 게이트 절연막 등에 대해 다양한 연구가 진행되고 있다. 이번 연구에서 게이트 절연막을 가장 널리 이용되는 질화막 (산화막)을 CVD법을 이용하였다. 온도 가변 이전에 파워, 가스비 등의 공정을 진행하였으며, 이 후 최적 조건을 이용하여 온도 가변을 진행하였다. 200도 미만의 극저온 공정에서의 절연막 특성을 고온에서의 절연막 특성과 비교 분석 하였다.

**Keywords:** 저온, 게이트 절연막